Zeeman効果を用いた ポジトロニウム超微細構造の 精密測定

東大理,東大素セ^A,東大院総合文化^B, KEK^C

<u>石田明</u>, 秋元銀河, 佐々木雄一, 宮崎彬, 加藤康作, 末原大幹^A, 難波俊雄^A, 浅井祥仁, 小林富雄^A, 斎藤晴雄^B, 吉田光宏^C, 田中賢一^C, 山本明^C

2010年3月23日 日本物理学会第65回年次大会 於岡山大学

1

- イントロダクション
 (磁場を用いた O(ppm)の精密測定)
- ・我々の新しい実験セットアップ
- ・プロトタイプ測定とその結果
- ・今後の展望

ポジトロニウム超微細構造(Ps HFS)とずれ

(基底状態の)ポジトロニウム超微細構造(Ps HFS)

=o-Psとp-Psのエネルギー準位差 (203GHz, スピン・スピン相互作用)



系統誤差を小さくした 新しい精密測定実験で、 Ps HFSのずれを検証する。

Zeeman効果を用いた間接測定の方法



我々の新しい実験セットアップ

測定の原理は過去と同じ (Zeeman効果を使った間接測定) だが、

過去の問題点(磁場の非一様性、物質の効果)を解決するため新しい方法を用いる。



プロトタイプ測定 @ KEK低温棟

- 新しいセットアップの設計、実機製作を行い、遷移曲線、 超微細構造を実際に測定。系統誤差を洗い出した。
- ・ 目標精度は数 10 ppm (最終目標はO(ppm))。
- 2009年7月から9月に測定



プロトタイプ測定 @ KEK低温棟

- 新しいセットアップの設計、実機製作を行い、遷移曲線、 超微細構造を実際に測定。系統誤差を洗い出した。
- 目標精度は数 10 ppm (最終目標はO(ppm))。
- 2009年7月から9月に測定



解析



共鳴曲線







 $\Delta_{\rm HFS}$ = 203.380 4 ± 0.002 2 (stat., 11 ppm) ± 0.008 1 (sys., 40 ppm) GHz



	系統誤差の要因	大きさ (ppm)
٢	磁場の非一様性	21
磁場 ┥	磁場補正	4
	磁場測定値	2
MC	モンテカルロ・シミュレーションの統計	17
	モンテカルロ・シミュレーションの磁場依存性	18
物質の」	ポジトロニウムの熱化	20
効果	密度依存性 (熱化以外)	7
	RF パワー P	5
RF →	RF キャビティーのQ _L	6
L	_RF周波数	5
	Quadrature sum	40

今後の展望

- 磁場:最大の系統誤差である磁場の非一様性を克服するため、補償磁石を用いる。磁場精密測定の結果を基に、設計した。実機製作中。試験的に測定を行う(4月以降)。O(ppm)の磁場一様性を得る。
- MC: MCを研究し、系統誤差をO(ppm)に抑える。
- 物質の効果:ポジトロニウムの熱化関数を精密に測定する。(→佐々木のトーク)
- RF:温度管理でO(ppm)を達成する。
- 統計誤差: プロトタイプ測定で、85日で11 ppm. DAQレートの向上や、24時間測定などにより、2年以内に4 ppm以下にする。
- 本測定を5月以降に開始し、2011年内をメドに、O(ppm)の測 定を終える。

補償磁石



まとめ

- 重要な物理量である、ポジトロニウム超微細構造が、
 実験と理論で一様に 3.9 σ ずれている。
- ポジトロニウム超微細構造の精密測定に向け、約 3ヶ月間、プロトタイプ測定を行った。
- プロトタイプ測定で、過去の実験値・理論値と無矛 盾な結果が、41 ppm で得られた。
- ・現在、最大の系統誤差は、磁場の非一様性。
- 補償磁石の開発、ポジトロニウム熱化関数の測定 などにより、系統誤差をO(ppm)に抑える。
- 2年程度で、物質の効果を入れて O(ppm)の精度を 達成する。